

⑫ 公開特許公報 (A) 昭60-233156

⑬ Int. Cl.⁴
 C 09 B 26/02
 // G 03 G 5/06
 H 01 L 31/08

識別記号

厅内整理番号

⑭ 公開 昭和60年(1985)11月19日

6785-4H
 7124-2H
 7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

⑮ 発明の名称 新規なビスヒドラゾン類

⑯ 特願 昭59-89056

⑰ 出願 昭59(1984)5月2日

⑱ 発明者 鈴木 哲身 横浜市緑区鶴志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合研究所内
 ⑲ 発明者 小野 均 横浜市緑区鶴志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合研究所内
 ⑳ 発明者 横山 道代 横浜市緑区鶴志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合研究所内
 ㉑ 出願人 三菱化成工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号
 ㉒ 代理人 弁理士 長谷川 一 外1名

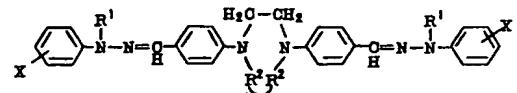
明細書

1 発明の名称

新規なビスヒドラゾン類

2 特許請求の範囲

(1) 下記一般式 [1]



..... [1]

(上記式中で、R¹は水素原子、アルキル基、フェニル基、置換フェニル基、ナフチル基、アリル基またはベンジル基を表わし；R²はアルキル基、アリル基またはベンジル基を表わし、また2つのR²は互いに結合してアルキレン基を表わしてもよく；Xは水素原子、アルキル基、アルコキシ基またはハロゲン原子を表わす。)で表わされるビスヒドラゾン類。

3 本発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は新規なビスヒドラゾン類に関するものであり、詳しくは、電子写真用感光体として有用なビスヒドラゾン類に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、電子写真用感光体の感光層にはセレン、硫化カドミウム、酸化亜鉛等の無機系の光導電性物質が広く用いられていた。近年、有機系の光導電性物質を電子写真感光体の感光層に用いる研究が進み、そのいくつかが実用化された。有機系の光導電性物質は無機系のものに比し、軽量である、成膜が容易である、感光体の製造が容易である、種類によつては透明な感光体を製造できる等の利点を有する。

有機系光導電性物質としてはポリビニルカルバゾールをはじめとする光導電性ポリマーに関する研究が多くなされてきたが、これらのポリマーは必ずしも皮膜性、可とう性、接着性などが十分ではなく、薄いフィルムにした場合ヒビ割れたり基材から剥離したりしがちである。これらの欠点を改良するために可塑剤、ペインダ

一などが添加されるが、これにより感度が低下したり、残留電位が増大するなどの別の問題が生じやすいため、実用的な感光体を得るのは極めて困難であつた。

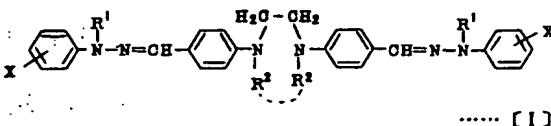
一方、有機系の低分子光導電性化合物は、ペインダーとして皮膜性、可とう性、接着性などのすぐれたポリマーを選択することができるので容易に機械的特性の優れた感光体を得ることができるので高感度な感光体を作ることに適した化合物を見出すことが困難であつた。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明の目的は、高感度及び高耐久性の電子写真用感光体を与える有機系の低分子光導電性化合物を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

高感度の電子写真用感光体として有用な本発明のビスヒドラゾン類は下記一般式[I]で表わされる。



[上記式中で、 R^1 は水素原子、アルキル基、フェニル基、置換フェニル基、ナフチル基、アリル基またはベンジル基を表わし； R^2 はアルキル基、アリル基またはベンジル基を表わし、または2つの R^2 は互いに結合してアルキレン基を表わしてもよく； X は水素原子、アルキル基、アルコキシ基またはハロゲン原子を示す。]で表わされるビスヒドラゾン類に存する。

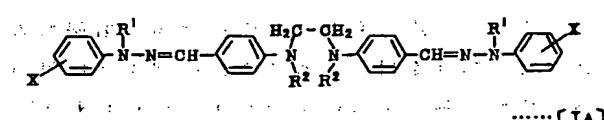
以下に本発明を詳細に説明する。

上記式中において、アルキル基、アルコキシ基としては炭素数1～10のものが好ましい。アルキレン基としては炭素数2～3のものが挙げられる。ハロゲン原子としては塩素原子、臭素原子等が挙げられる。また、置換フェニル基としては、好ましくは炭素数1～10のアルキル基もしくはアルコキシ基または塩素原子、臭

- 3 -

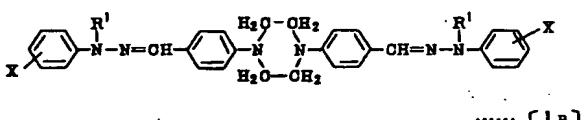
臭素原子等のハロゲン原子で置換されたフェニル基が挙げられる。

更に、具体的には上記一般式[I]の化合物は、たとえば次の一般式[IA]および[IB]で表わされるが、下記式中の R^1 、 R^2 および X は下記表に示すとおりである。



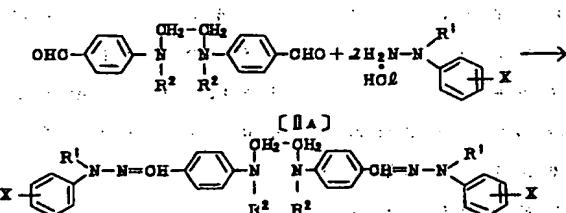
R^1	R^2	X
-H	-O ₂ H ₅	-H
-O ₂ H ₅	-O ₂ H ₅	-H
-O ₂ H ₅	-O ₂ H ₅	-H
-C ₆ H ₅	-CH ₂ -OH=CH ₂	-H
-CH ₂ -O-	-CH ₂ -O-	-OOH ₅
-CH ₂ -O-C ₆ H ₄ -OCH ₃	-CH ₂ -O-C ₆ H ₄ -OCH ₃	-OCH ₃
-C ₆ H ₄ -O-	-O ₂ H ₅	-O ₂ H ₅

- 4 -



R^1	X
-H	-H
-O ₂ H ₅	-H
-C ₆ H ₅	-H

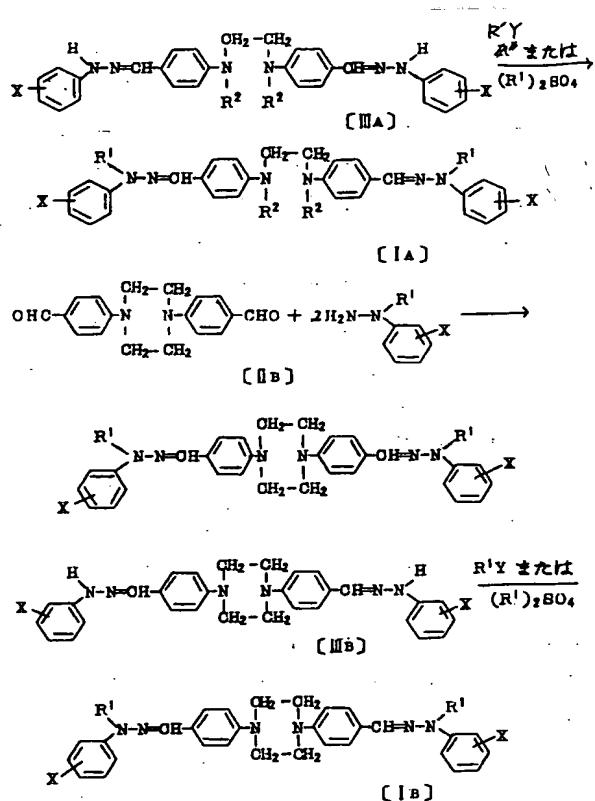
上記化合物は、下記に示されるビスアルデヒド[IIA]または[IB]とヒドラジン類とを出発原料として以下に示す公知の方法により製造される。



- 5 -

-418-

- 6 -



(上記式中で、Yはハロゲン原子を表わす。)出発原料であるビスアルデヒド[IIa]または[IIb]とヒドラジン類との縮合反応は、メタノール、エタノール、ブロボノール、テトラヒドロフラン、ジオキサンの如き反応に不活性な溶剤中、場合によつては酢酸、塩酸、p-トルエンスルホン酸等の触媒を用いて加熱することにより行われる。

特に、一方の原料であるヒドラジン類がフェニルヒドラジン、置換フェニルヒドラジン類である場合には上記のとおり縮合物[IIIa]もしくは[IIIb]をジオキサン、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン等の反応に不活性な溶剤中、ハロゲン化アルキル、ジアルキル硫酸、アリルハライド、ベンジルハライド等を用い、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムの如き脱酸剤を併用して公知のアルキル化、アリル化、ベンジル化を行なうことにより本発明の化合物を製造できる。

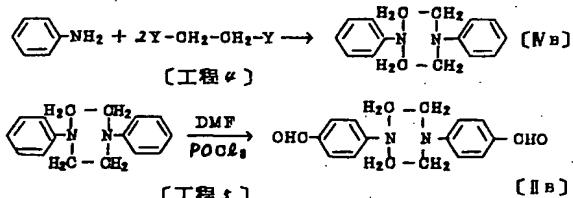
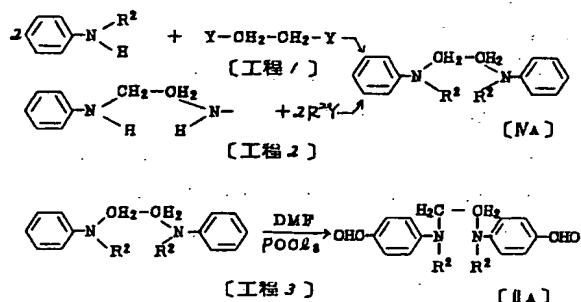
反応生成物は通常、反応中に析出してくるが、

- 7 -

場合によつては(特に最後にアルキル化、アリル化、ベンジル化を行なう場合)溶解していることもある。この場合、反応終了後冷却し、適宜、水、アルコール等で希釈すると結晶が容易に単離できる。

更に、所望によつては懸濁、再結晶、カラム処理、昇華等の公知の手段により生成物の純度を高めることも可能である。

ビスアルデヒド[IIa]もしくは[IIb]は例えば以下の反応式で示される公知の方法に従つて製造できる。



(上記式中で、Yはハロゲン原子を表わす。)

上記合成条件(工程1～5)を具体的に説明するとまず[工程1]では、1,2-ジハロゲノエタンと少く共2倍モル以上のモノアルキルアニリンとを、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、キノリン、ピリジン等の脱酸剤の存在下、0℃～200℃、好ましくは100℃～150℃の温度下、1時間～10時間加熱して反応を進行させ、未反応、若しくは過剰のモノ置換アニリンを水蒸気蒸留により除去すると[IIa]が得られる。

[工程2]では、N,N'-ジフェニルエチレンジアミンと少く共2倍モル以上のハロゲン化アルキル、アリルハライドあるいはベンジルハラ

元素分析値

	O%	H%	N%
計算値	78.75	8.13	13.12
実測値	78.59	8.00	12.91

本化合物の赤外吸収スペクトルは第2図に示すとおりであつた。

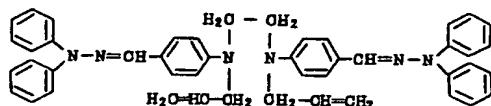
実施例3

N,N'-ジフェニルエチレンジアミン2タ、アリルブロミド3.0タおよび炭酸ナトリウム2.6タを4つロフラスコ中に仕込み、最初室温下、2時間搅拌した。搅拌を開始すると共に徐々に発熱すると同時に反応物の体積が増加していくので氷水浴中に反応器を浸し、搅拌しながら発熱を抑えた。約30分で発熱がおさまつたので室温に戻し、30分搅拌の後、反応系を75°～80°Cに加温し4時間搅拌した。

反応終了後、常法により後処理してN,N'-ジフェニル-N,N'-ジアリルエチレンジアミン(油状)を得た。

-15-

点(183-185°C) 3.3タを得た。



元素分析値

	O%	H%	N%
計算値	81.17	6.47	12.35
実測値	80.93	6.31	12.17

本化合物の赤外吸収スペクトルは第3図に示すとおりであつた。

実施例4

実施例3においてジフェニルヒドラジンの代わりにN-メチルフェニルヒドラジンを使用する他は実施例3に記載の方法に準じて、下記構造式で表わされる淡黄色結晶(融点164-166°C)を純品として得た。

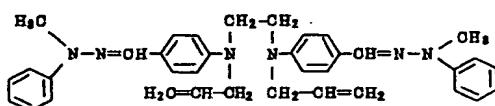
次いで得られたN,N'-ジフェニル-N,N'-ジアリルエチレンジアミン2タをN,N'-ジメチルホルムアミド10タに混合し、オキシ塩化リソノタタを20°C以下で滴下した。滴下終了後系を加温し、60-65°Cで4時間搅拌後更に85°-90°Cで5時間反応させ、反応終了後放冷し、反応液を氷水浴中へ搅拌しながら徐々に放出した。1時間搅拌した後、沪過、乾燥して目的とするビスアルデヒド体(融点92-94°C)を得た。

次いでビスアルデヒド2タをエタノール50ml中に懸濁し、加熱、溶解させた。系内ヘジフェニルヒドラジンを3.8タ加え、還流下1時間反応させた。

反応終了後、放冷し、析出する結晶を沪取し、更にクロロホルムに再溶解させたのち溶液中へ活性白土、活性炭を各々100mgずつ加え、よく振つて沪過した。

沪液を濃縮し、メタノールにより結晶を析出させて下記構造式で表わされる淡黄色結晶(融

-16-



元素分析値

	O%	H%	N%
計算値	77.69	7.19	15.11
実測値	77.48	7.01	14.98

本化合物の赤外吸収スペクトル測定結果は第4図に示すとおりであつた。

実施例5

アニリン28タ、1,2-ジプロモエタン55タおよび炭酸ナトリウム64タを4つロフラスコに仕込み、密閉雰囲気下、130°Cで、1.5時間反応させた。反応終了後、放冷し、内温が60°Cに降下したのち、クロロホルム500mlを加え5時間放置後クロロホルム溶液を抜き、残渣が残つてはいる4つロフラスコ内へ更に500mlクロロホルムを加え温水浴で3時間加熱(50

て）した。

クロロホルム液を併せて水と共に分液ロートで振り、クロロホルム層を分液後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濃縮してメタノールにより結晶化させた(粗結晶 16g)。

粗結晶をクロロホルムとメタノールで再結晶精製を行ない融点 $162-163^{\circ}\text{C}$ (文献値 163°C) の白色結晶 139 を得た。

次いで N,N-ジメチルホルムアミド / 28 中
にオキシ塩化リン / 2.6g を室温で滴下し、ホル
ミル化剤を調整した。

別に N,N'-ジフエニルビペラジン 9.5 g を N,N'-ジメチルホルムアミド 200 mL 中に懸濁した溶液をホルミル化剤溶液の中へ 20 °C 以下で 1 時間かけて滴下した。滴下終了後反応系を加温し、系の温度を 85 °C ~ 90 °C に保つて 6 時間攪拌を続行した。

反応終了後常法によりビスアルデヒド体 1.0
g を得た。

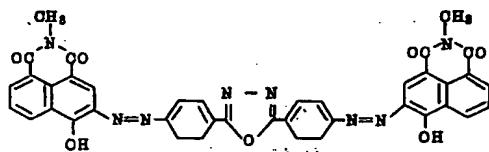
次いで得られたビスマルチヒドロ体ヨタをメタ

- 19 -

本化合物の赤外吸収スペクトルは第5図に示すとおりであつた。

試驗例：

下記構造式



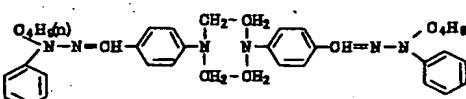
で表わされるナフタル酸系ビスアゾ顔料 1.4 部
とフエノキシ樹脂（ユニオンカーバイド社製、
商標 PKHH ） 2.79 とを 100 g のシクロヘキ
サノンに分散させ、サンドグラインダーを用い
て微粒子化処理をした。

この分散微粒子液を、7.5 μ の膜厚のポリエステルフィルムに蒸着されたアルミ蒸着層の上に乾燥後の重量が 0.3 g/cm² になるようにワイヤーパーで塗布した後、乾燥して電荷発生層を形成させた。

この上に下記構造式（実施例3）

ノール 100 部中に懸濁し、ヨーフエニルヒド
ラジン 2.4% を添加して還流下 1 時間攪拌した。
反応終了後析出物を沪取し乾燥してビスヒドラ
ゾン粗結晶 4.4%を得た。

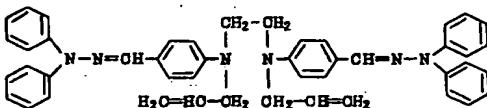
更に、得られた粗品ビスピドラゾン4.3 g および水酸ナトリウム1.5 g をヨーメチルビロリドン/5 mL中に仕込み反応系を50°Cに加熱した。次いでこの反応系の中へ沃化ローブチル6.7 g を15分かけて滴下し、滴下終了後2時間、80°Cにて反応させた。反応終了後常法に従つて下記構造式で表わされる淡黄色結晶（融点181/-182°C）2.5 g を得た。



元素分析值

	O%	H%	N%	
$C_{25}H_{46}N_6$	計算値 77.52	実測値 77.59	7.85 7.59	14.33 14.18
として				

— 20 —



で表わされるビスヒドラゾン40部とポリエス
テル(東洋紡社製、商標バイロン85)100
部をトルエン570部に溶解した溶液を乾燥後
の膜厚が13μになるようにフィルムアブリケ
ーターで塗布した後、乾燥し、電荷移動層を形
成させた。

このようにして得た 2 層から成る感光層を有する電子写真感光体について感度すなわち半滅露光量 ($E_{1/2}$) を測定したところ $6.8 \text{ lux} \cdot \text{sec}$ であつた。

なお、半減露光量はまず感光体を暗所で-5.5 KVのコロナ放電により帯電させ(7.26 Vに帯電)、次いで白色光で露光し、表面電位が初期表面電位の十に減衰するのに要する露光量を測定することにより求めた。

- 21 -

—422—

- 22 -

4 図面の簡単な説明

第1図～第5図は、それぞれ実施例1～実施例5で得られた本発明化合物の赤外吸収スペクトル図である。

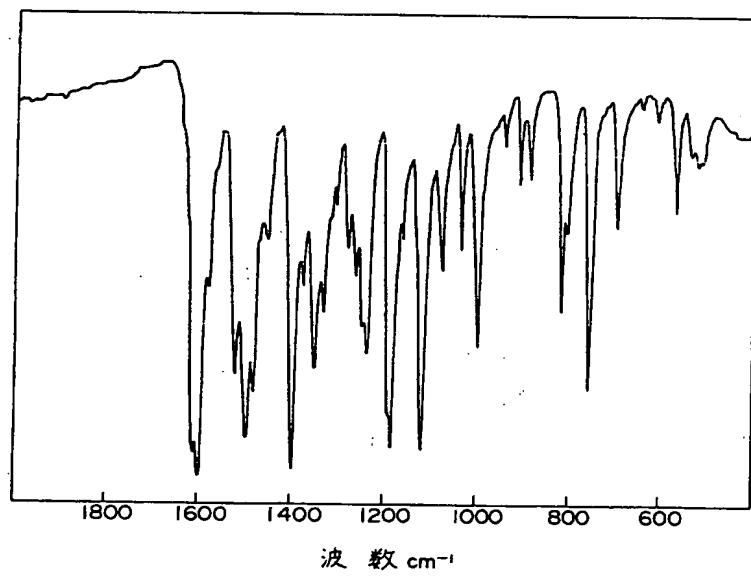
出願人 三菱化成工業株式会社

代理人 弁理士 長谷川 一

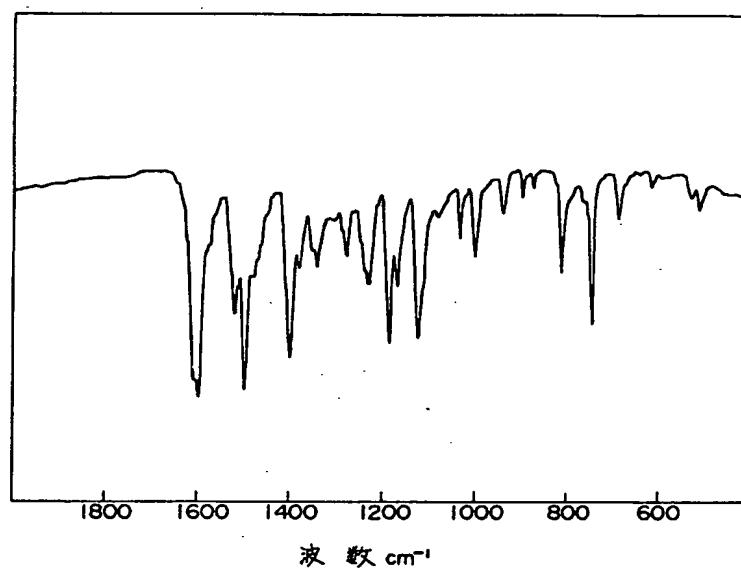
ほか／名

- 23 -

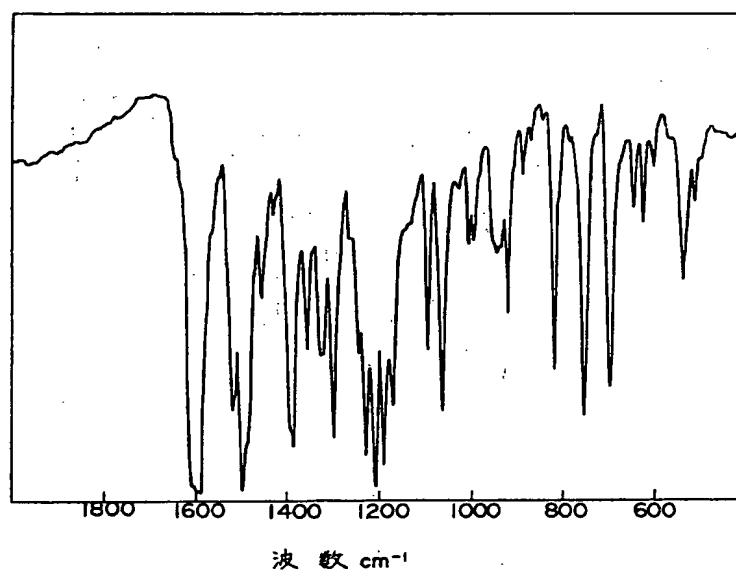
第1図



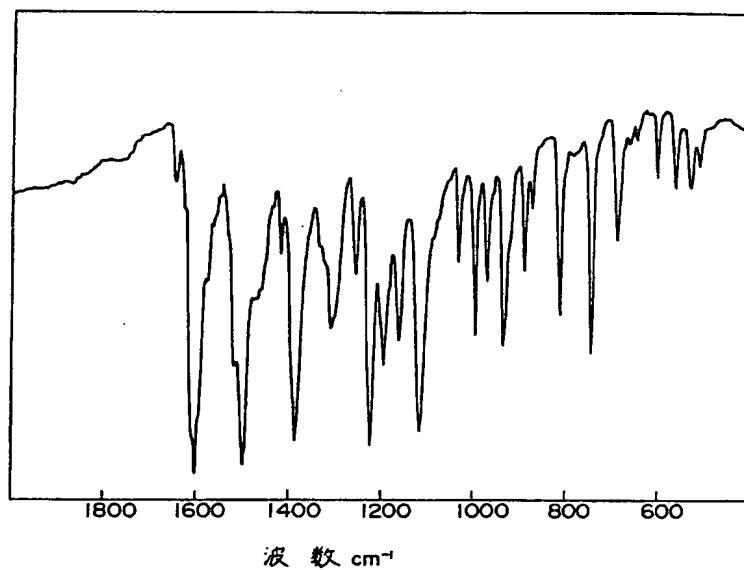
第2図



第3図



第4図



第5図

